

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【公表番号】特表2010-510185(P2010-510185A)

【公表日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2010-013

【出願番号】特願2009-536708(P2009-536708)

【国際特許分類】

C 0 7 C 303/28 (2006.01)

C 0 7 C 309/73 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 303/28

C 0 7 C 309/73

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成22年11月8日(2010.11.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

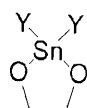
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ジオールのモノ - トシル化のための触媒的方法における、2 モル % ~ 0 . 0 0 0 5 モル % の濃度での式 ( I c )

【化 1】



( I c )

[ 式中、Y は C<sub>1-6</sub> アルキル、フェニル及びベンジルの群から選ばれる ]  
の総称的アセタールの使用。

【請求項 2】

式 ( I c ) の総称的アセタールの濃度が 0 . 1 モル % ~ 0 . 0 0 5 モル % である請求項 1 に記載の使用。

【請求項 3】

式 ( I c ) の総称的アセタールが 2 , 2 - ジブチル - [ 1 , 3 , 2 ] ジオキサスタンノランである請求項 2 に記載の使用。

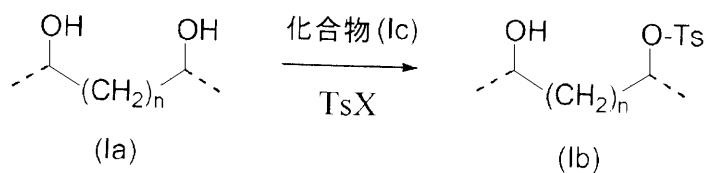
【請求項 4】

ジオールが少なくとも 2 個そして最高で 3 個の炭素原子により隔てられた少なくとも 2 個のヒドロキシ基を含んでなる部分である請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の使用。

【請求項 5】

請求項 1 において定義した式 ( I c ) の化合物を 2 モル % ~ 0 . 0 0 0 5 モル % の濃度で用いて、式 ( I a ) のジオール部分を含んでなる化合物を式 ( I b ) のトシル化ジオール部分を含んでなる化合物にトシル化する

## 【化 2】



[ 式中、

X は C l、B r 及び O T s の群から選ばれ；そして

n は 1 又は 2 に等しい整数である ]

段階を含んでなる ジオールの触媒的モノ - トシル化法。

## 【請求項 6】

式 ( I c ) の化合物の濃度が 0 . 1 モル % ~ 0 . 0 0 5 モル % である請求項 5 に記載の方法。

## 【請求項 7】

式 ( I c ) の化合物が 2 , 2 - ジブチル - [ 1 , 3 , 2 ] ジオキサスタンノランである請求項 6 に記載の方法。